

スパッタプロセスモニター SPM200

スパッタ蒸着(メタル成膜等)や反応性
プロセス中のガス組成をIn-situモニター

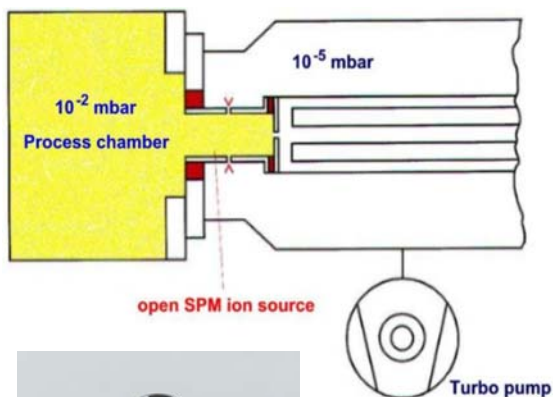
標準で最大測定圧力が1Pa
さらにオプションとして1000Paまで対応

プロセス開始前の残留ガス分析が可能

100%から100ppbレンジまでのプロセスガ
スを同時に測定



●優れたSPMイオンソース



SPMイオンソース

SPMイオンソースの利点はイオンフォー
メーション部のガス組成がプロセスガスの
それに一致していることです。イオン化室
がほぼプロセスチャンバーの一部となっ
ていて、脱離や吸着効果による変化を受け
ずにプロセスチャンバー内の状態を反映し
ます。よってSPMの分析チャンバー内のバ
ックグラウンドからの影響は無視できま
す。

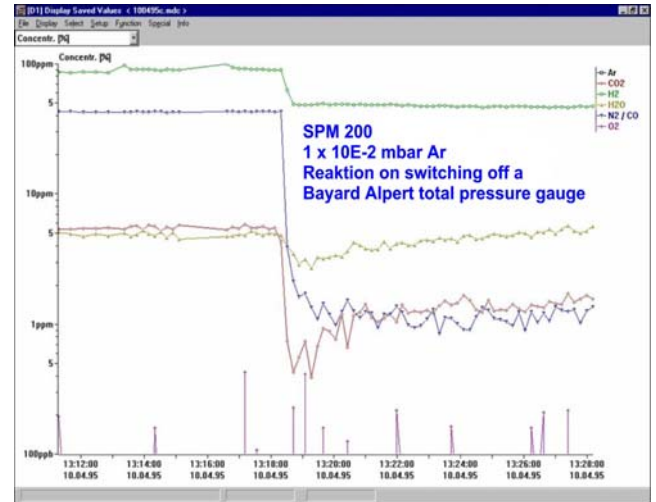
イオン化室とプロセスチャンバー間のコン
ダクタンスが大きいこととイオン化室と分
析チャンバー間のコンダクタンスが小さい
ことが主な理由です。

プロセス圧力でイオン化できることでデー
ターに高い信頼性を与えます。

●優れたソフトウェア Quadstar™

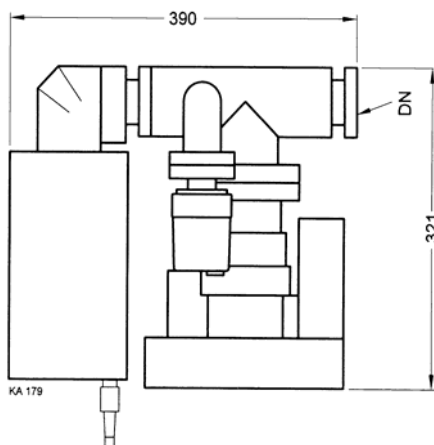
ソフトウェアの仕様と品質は真空の状態やプロセスガスをオンラインでかつ正確にモニターするために非常に重要です。そして特定のプロセスニーズに適合する必要があります。またスパッタ装置のコントローラと一体になる必要があります。Quadstarソフトウェアはこれらの要求に答えます。

SPMは対話形式のプリセットプログラムとともに供給されます。カスタマイズやアラーム設定も容易に出来ます。



●仕様

SPM 200



寸法図

マスレンジ	1…100amu
検出器	ファラデー/チャンネルトロン
最大プロセス圧力	1 Pa
検出限界 水素	< 3ppm
(アルゴン中) 水分	< 500ppb
窒素	< 100ppb
酸素	< 100ppb
二酸化炭素	< 100ppb
排気系 ターボ分子ポンプ	TMU071 60L/s
ダイアフラムポンプ	MVP015 15L/min
接続フランジ	DN40CF-F(ICF70)
重量	13 Kg

お手持ちの排気システムと組み合わせのできる
ポンプ無しの特別パッケージもご用意しております。